

2008年3月期中間決算説明会

2007年12月3日

株式会社ホロン

JQ7748

Solutions for Mask & Wafer Metrology

INDEX

1. 2008年3月期中間決算の概要
2. 2008年3月期の業績見通し
3. 主力製品EMUの性能向上と販売促進について

1. 2008年3月期中間決算の 概要

中間期損益(対予想比)

(単位:百万円)

	当初予想	07年9月期	対予想比	
	金額	金額	増減額	増減比(%)
売上高	210	106	△ 104	△49.5%
営業利益	△ 176	△ 181	△ 5	—
経常利益	△ 178	△ 180	△ 2	—
中間純利益	△ 179	△ 386	△ 207	—

当初予想:平成19年5月10日に公表した数値を使用しております。

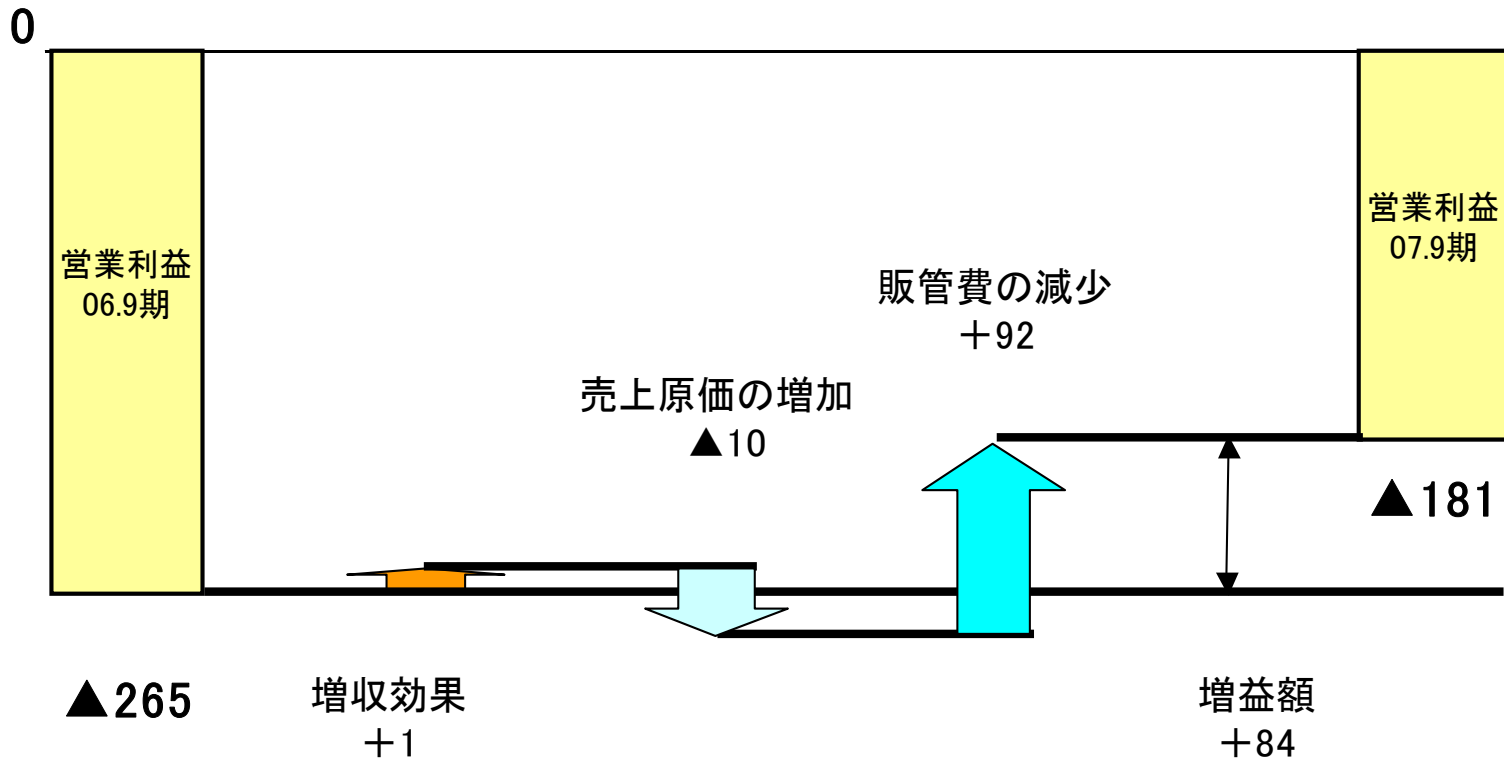
中間期損益(対前期比)

(単位:百万円)

	06年9月期		07年9月期		対前年同期比	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)	増減額	増減比(%)
売上高	105	100.0%	106	100.0%	1	1.0%
売上総利益	43	41.6%	34	32.9%	△ 9	△20.9%
販売費及び一般管理費	308	293.2%	216	203.7%	△ 92	△29.9%
営業利益	△ 265	△251.6%	△ 181	△170.8%	84	—
経常利益	△ 260	△247.4%	△ 180	△170.1%	80	—
中間純利益	△ 265	△251.5%	△ 386	△363.8%	△ 121	—

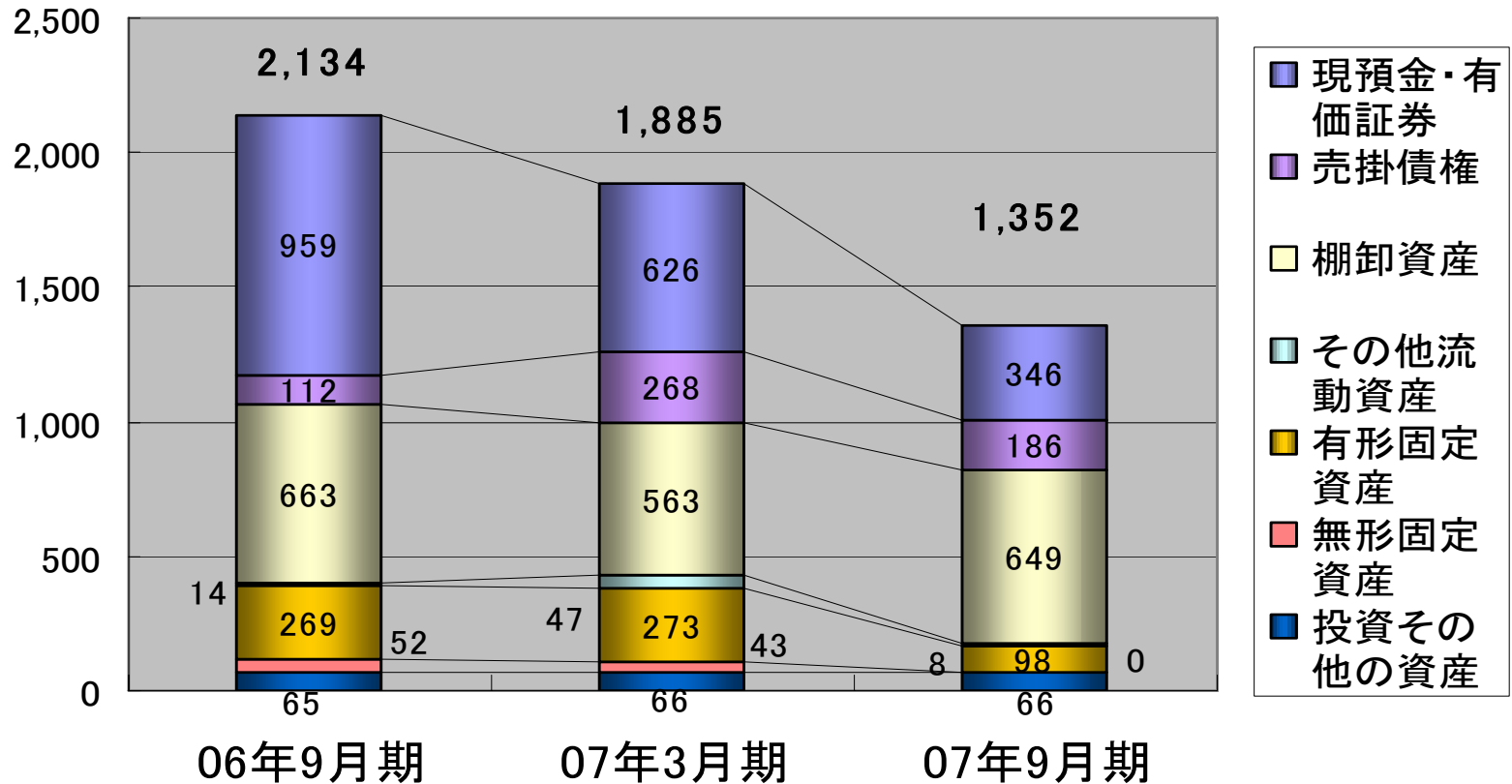
中間期営業利益 対前年同期比増減要因

単位: 百万円

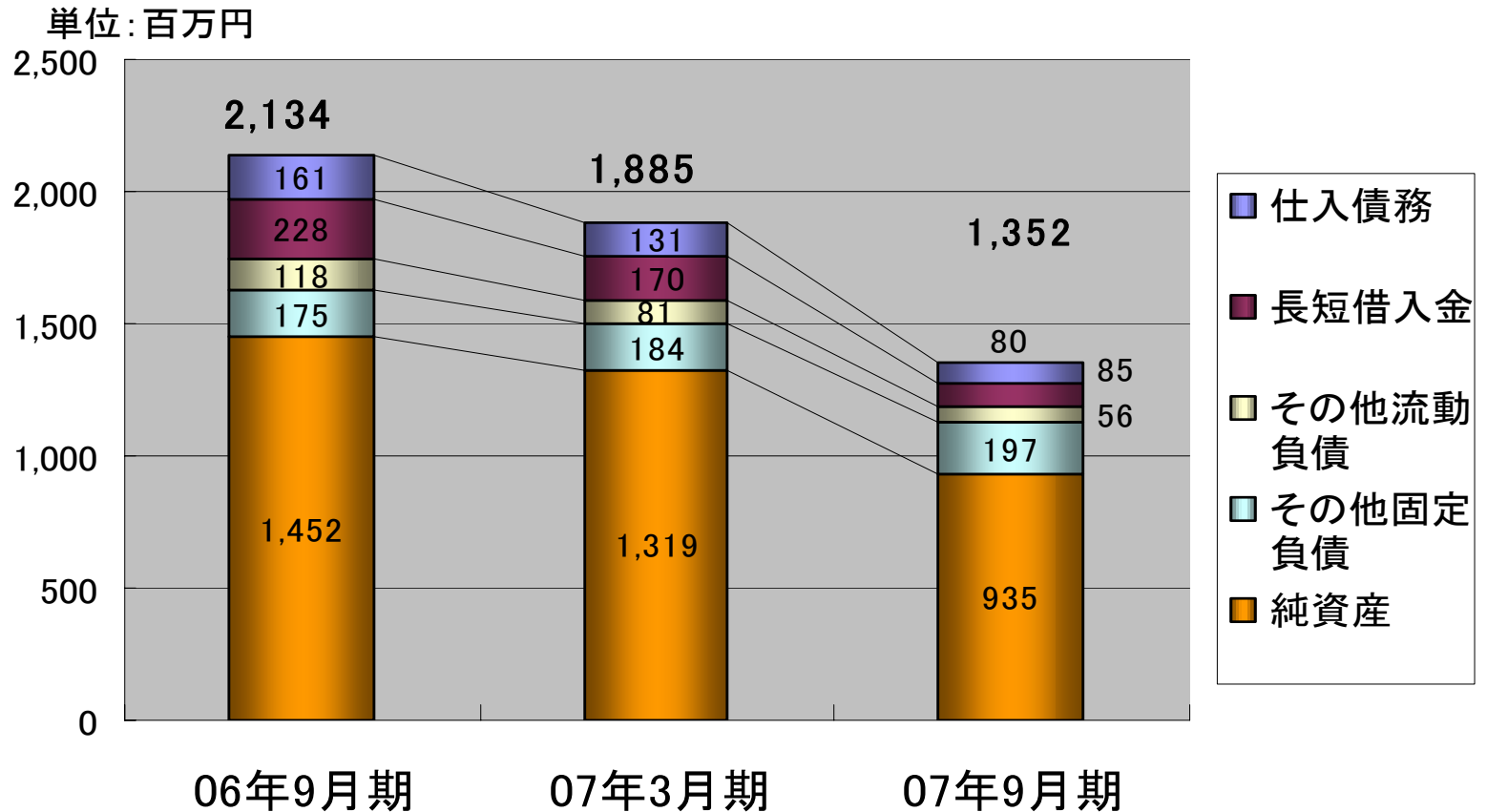


資産の状況

単位：百万円



負債・資本の状況



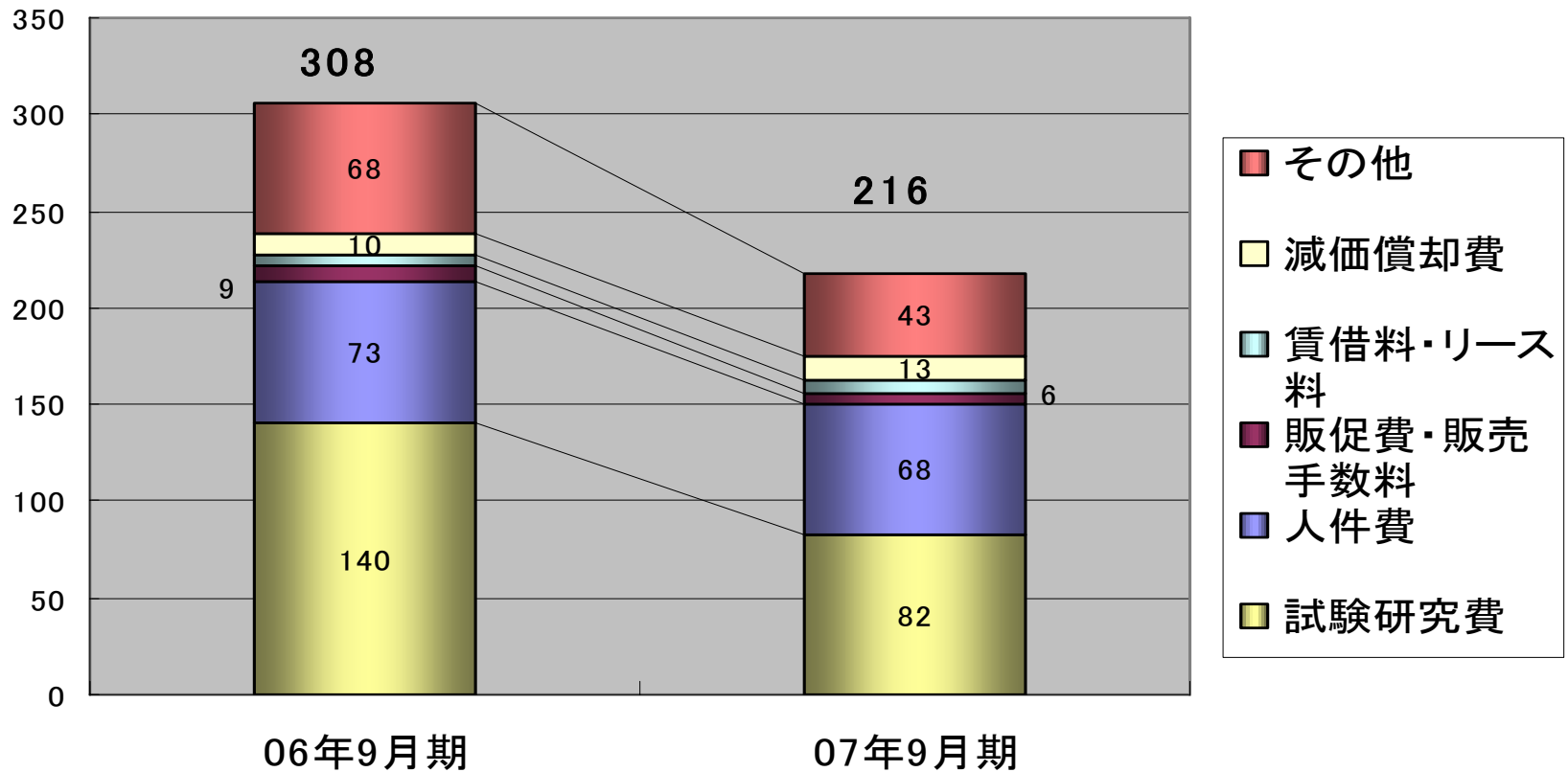
キャッシュフローの状況

(単位:百万円)

	06年9月期	07年9月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 220	△ 176	44
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34	△ 20	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	64	△ 83	△ 147
現金及び現金同等物の増加額	△ 189	△ 280	△ 91
現金及び現金同等物の中間期末残高	959	345	△ 614

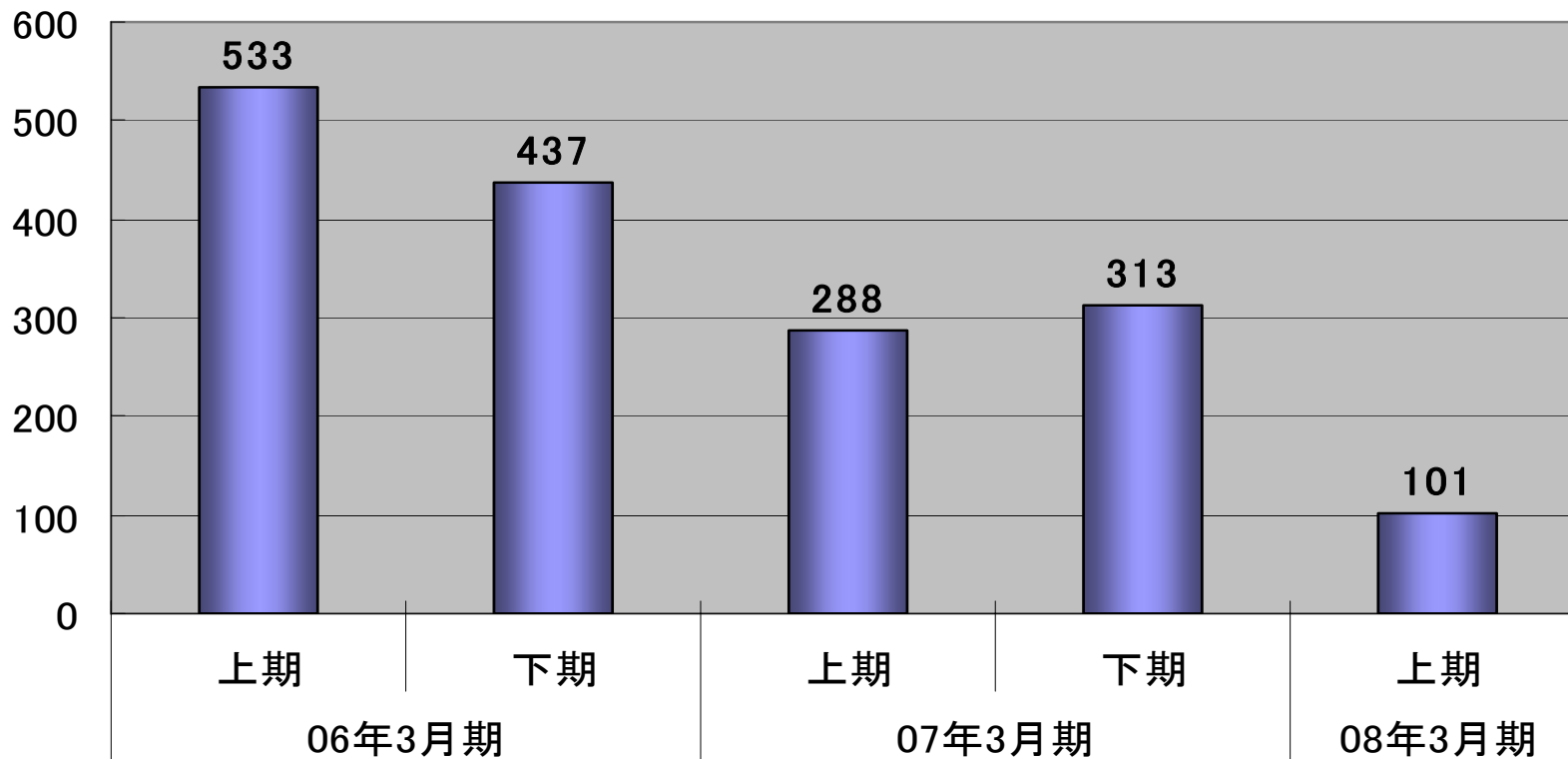
販管費の状況

単位：百万円



受注実績の状況

単位：百万円



2. 2008年3月期業績見通し

業績見通し

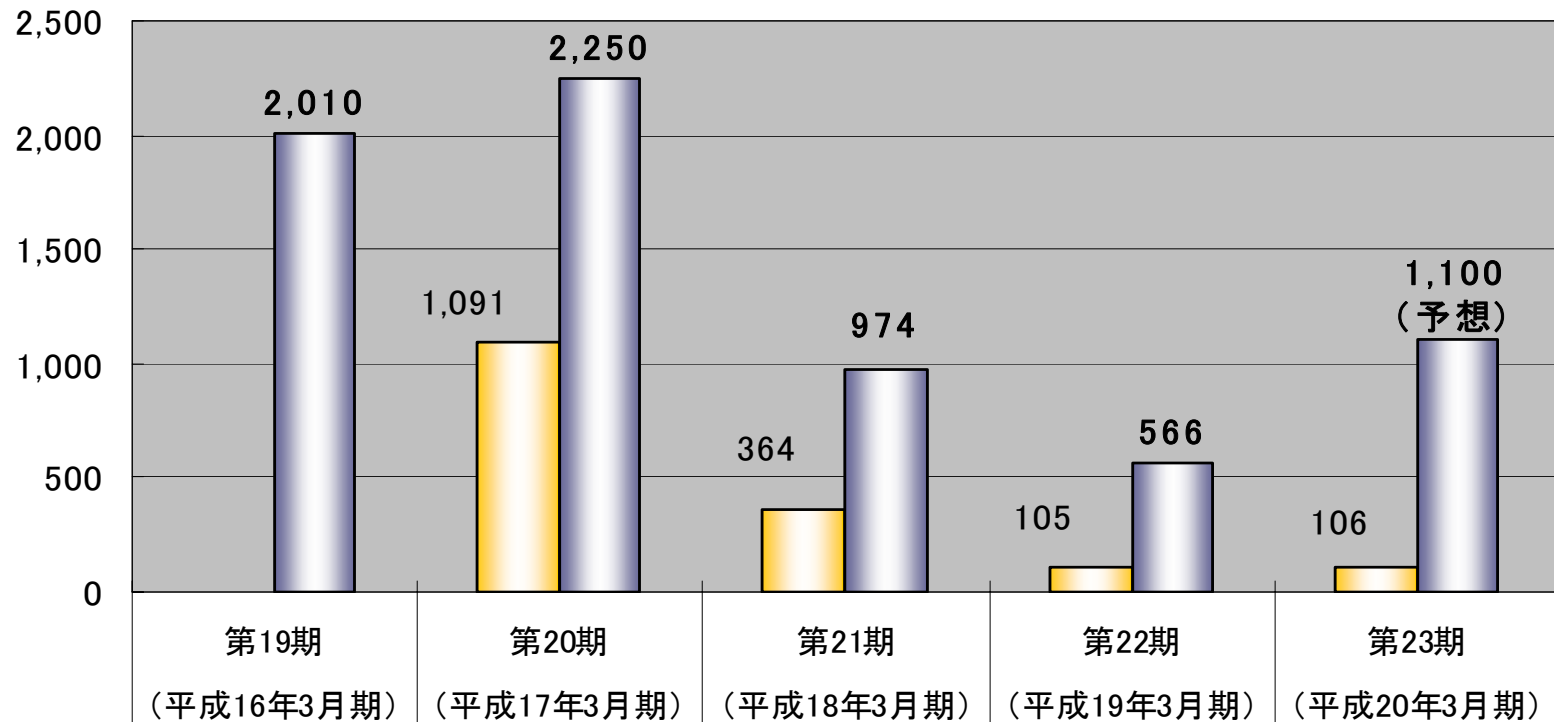
(単位:百万円)

	前期実績	08/3期予想	増減額	増減率	07/9期
売上高	566	1,100	534	94.3%	106
営業利益	△ 400	13	413	—	△ 181
(売上高比)	—	1.2%	—	—	—
経常利益	△ 396	13	409	—	△ 180
(売上高比)	—	1.2%	—	—	—
当期純利益	△ 398	△ 57	341	—	△ 386
(売上高比)	—	—	—	—	—

売上の推移(中間・期末)

(単位:百万円)

■ 中間 ■ 通期

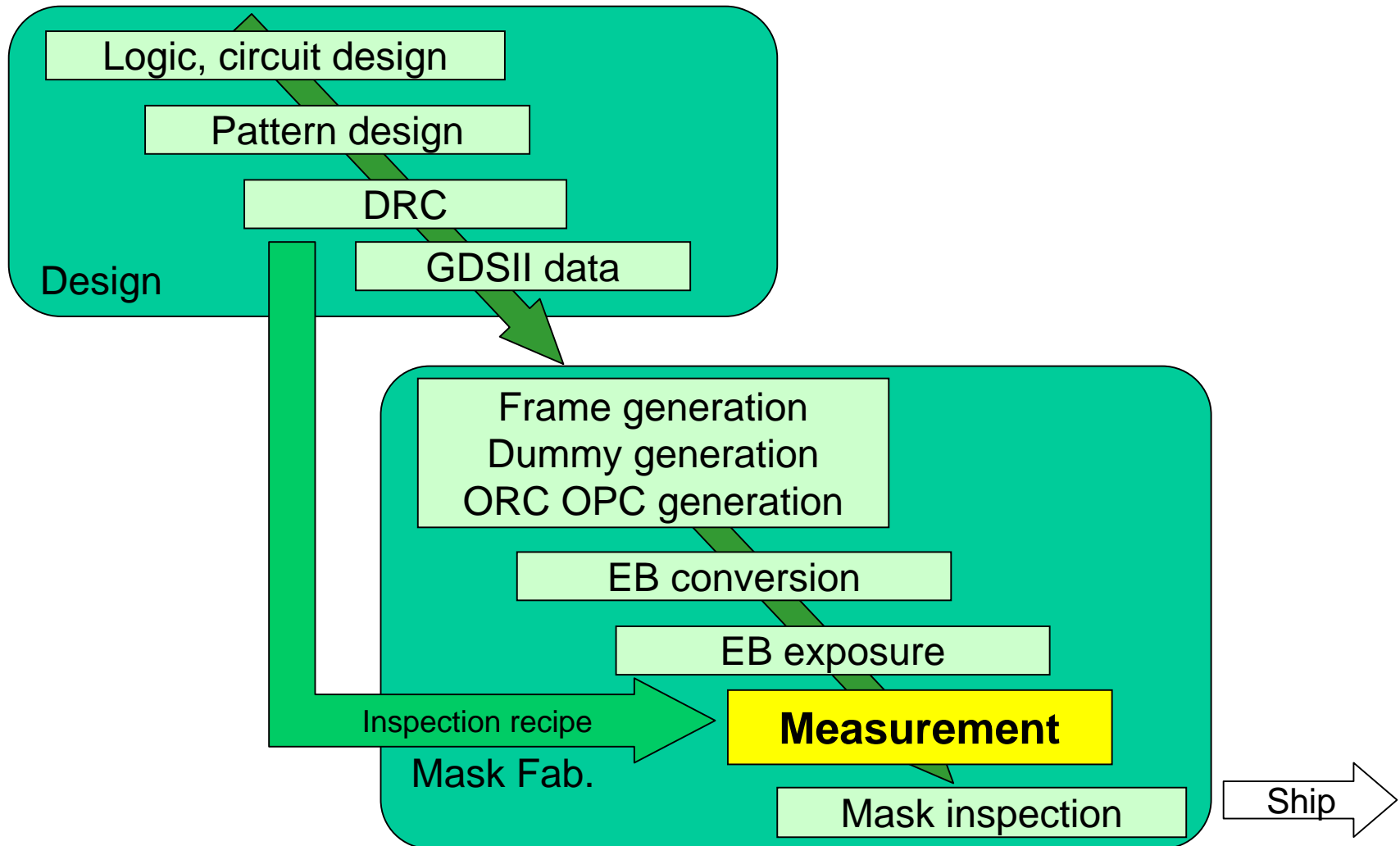


※第19期は中間監査を受けておりません。

3. 主力製品EMUの性能向上と 販売促進について

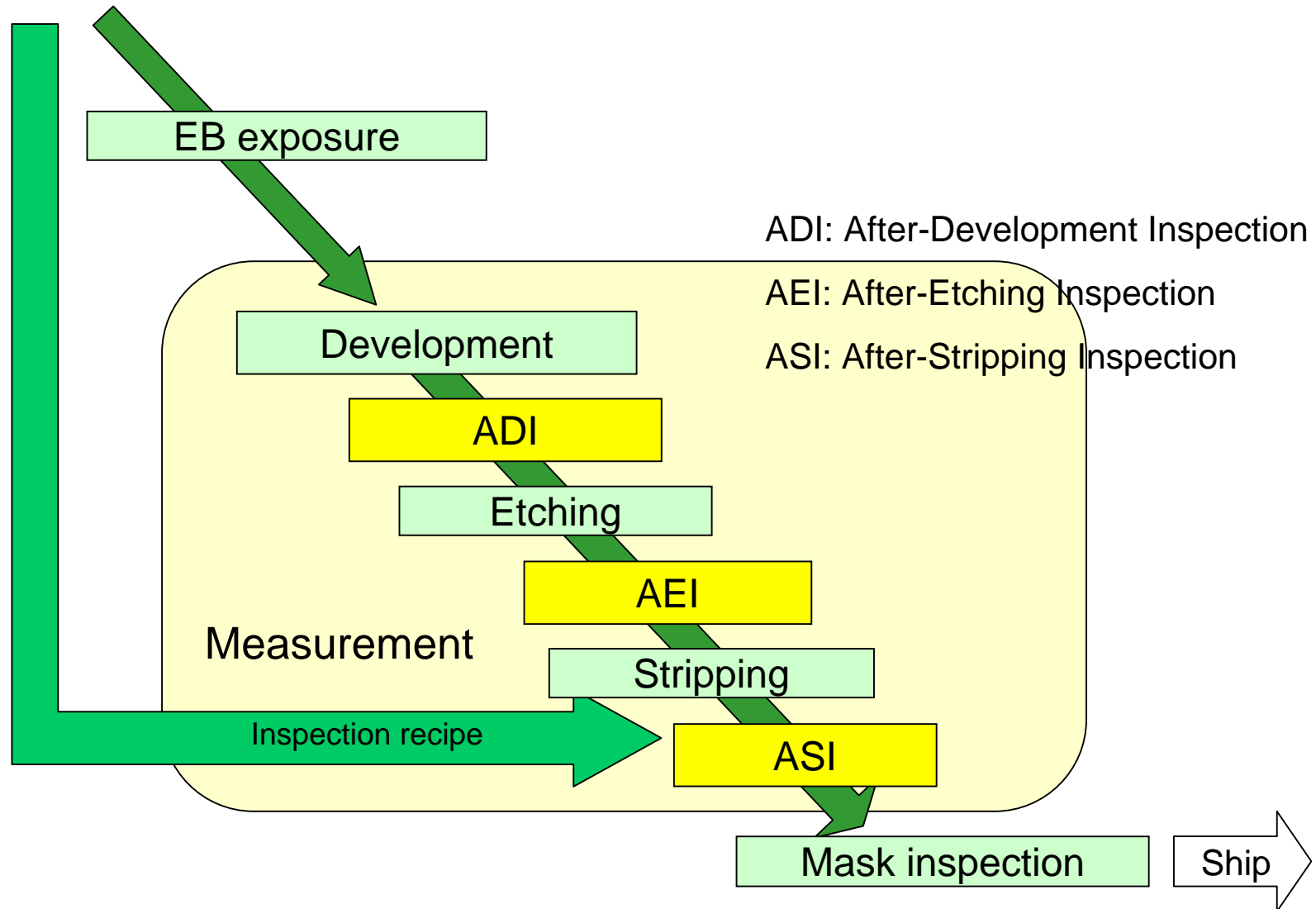
マスク製造工程

3.主力製品EMUの性能向上と販売促進について



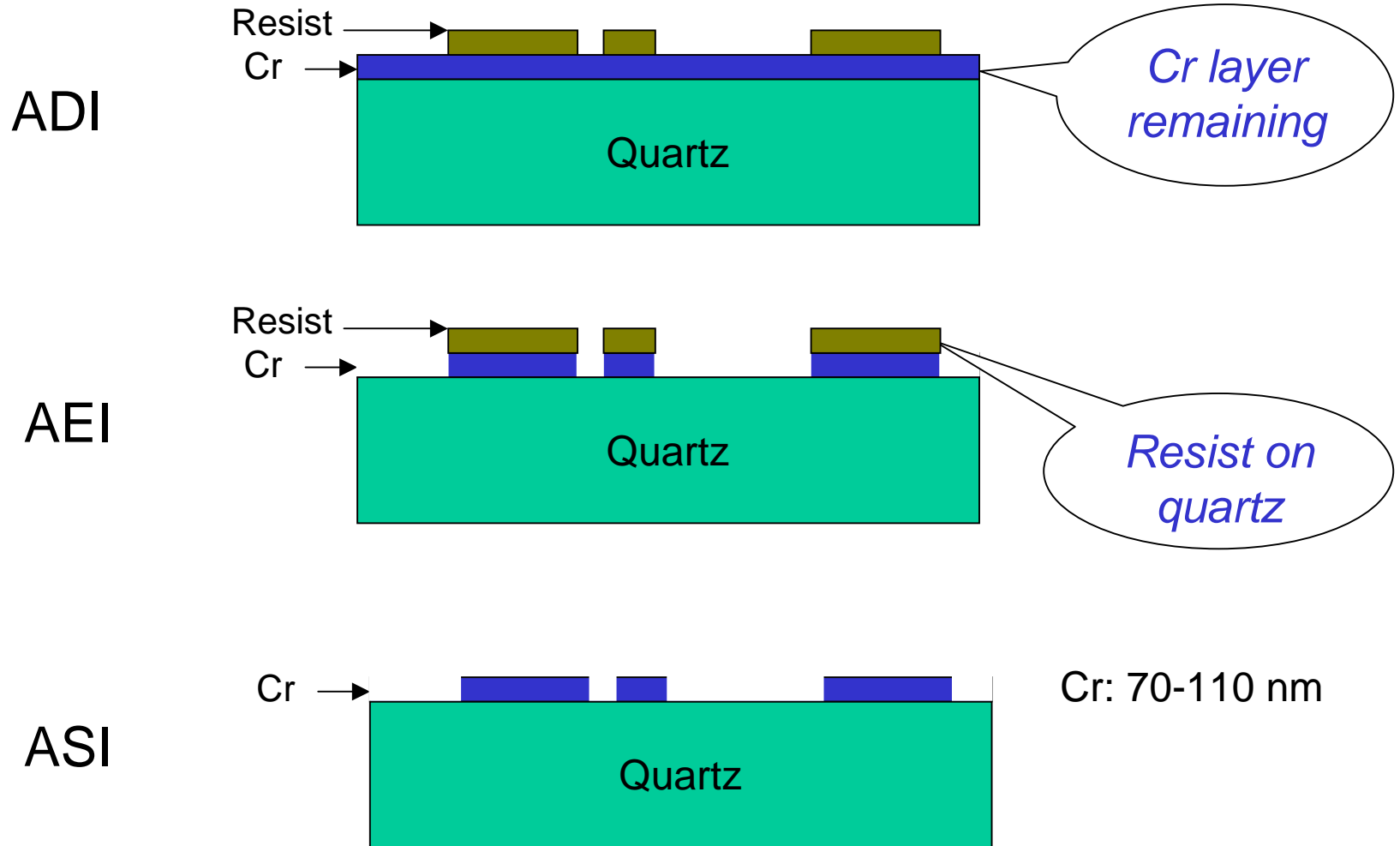
マスク検査（寸法測定）

3.主力製品EMUの性能向上と販売促進について



3タイプのマスク断面図

3.主力製品EMUの性能向上と販売促進について



EMU-270 3つの特徴

3.主力製品EMUの性能
向上と販売促進について

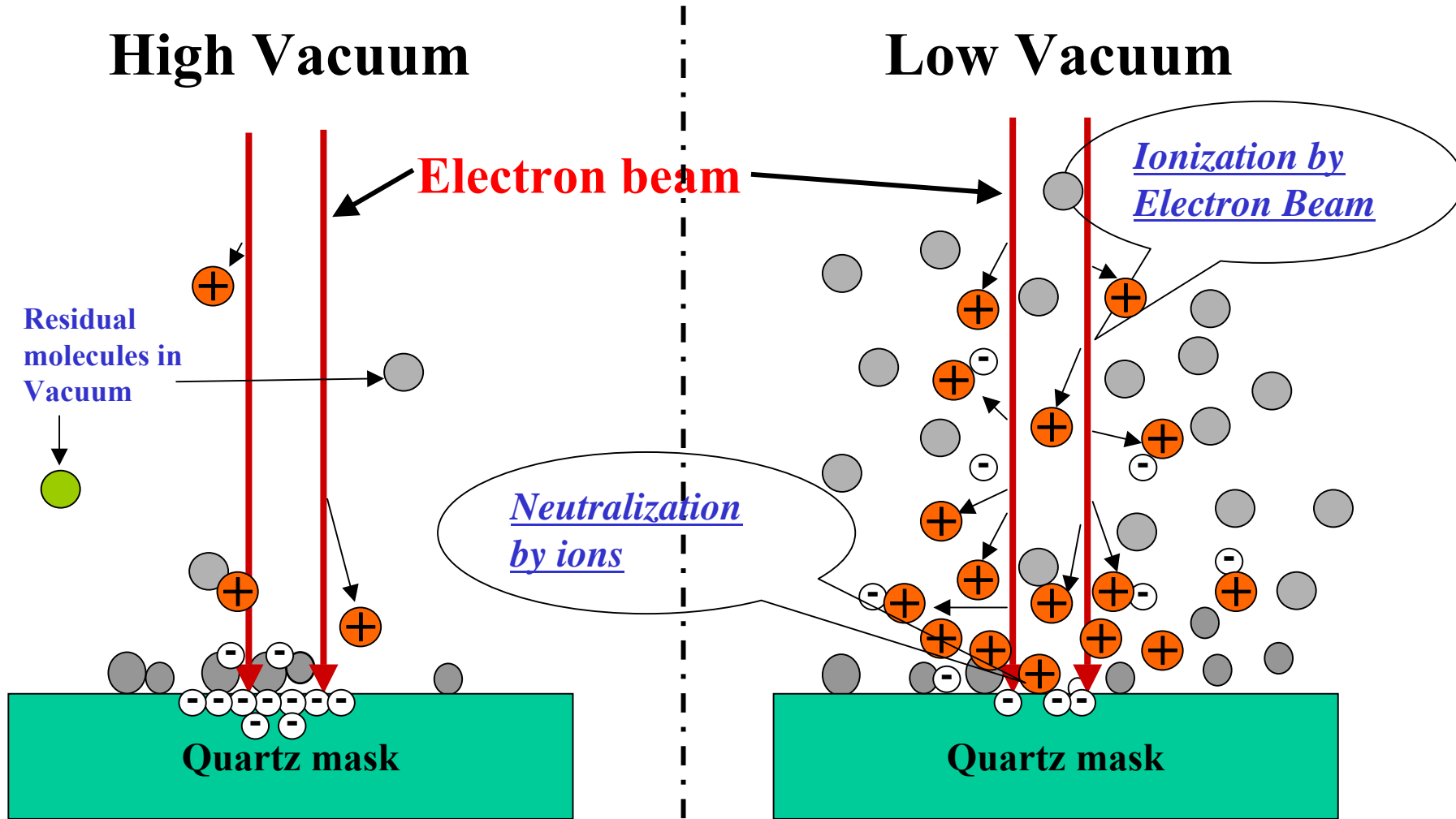
Low Vacuum Technology
(低真空技術)

AB-Corrector
(収差補正技術)

Automated Measurement
(自動測定)

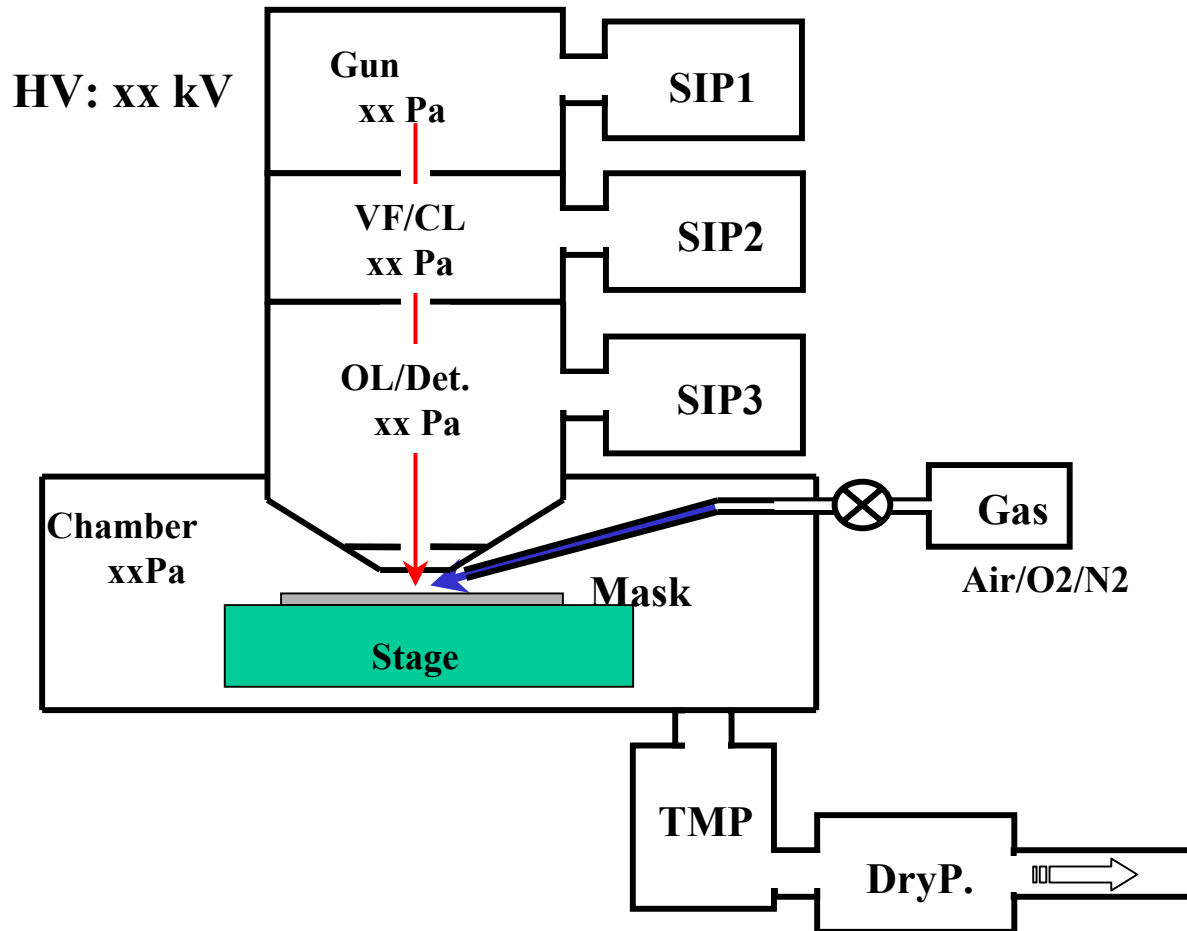
低真空内でのチャージの低減

3.主力製品EMUの性能向上と販売促進について



EMUの差動排気システム

3.主力製品EMUの性能向上と販売促進について



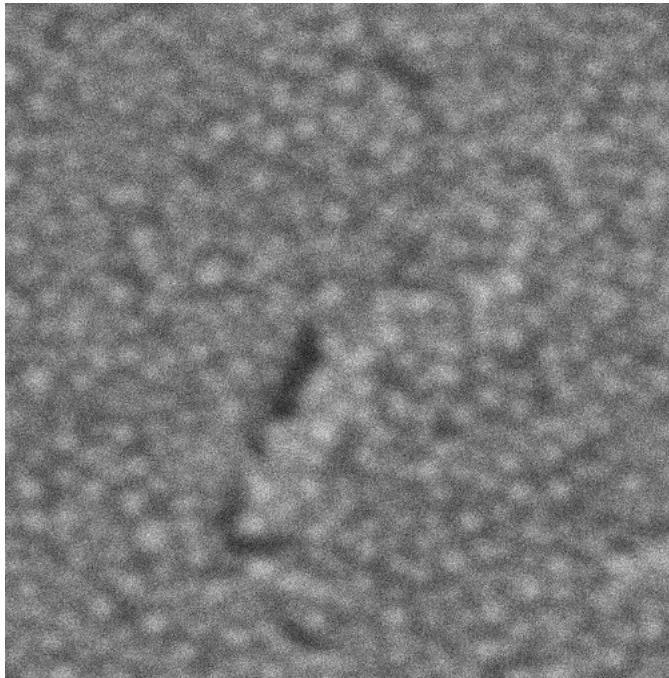
EMUの解像度比較

3.主力製品EMUの性能
向上と販売促進について

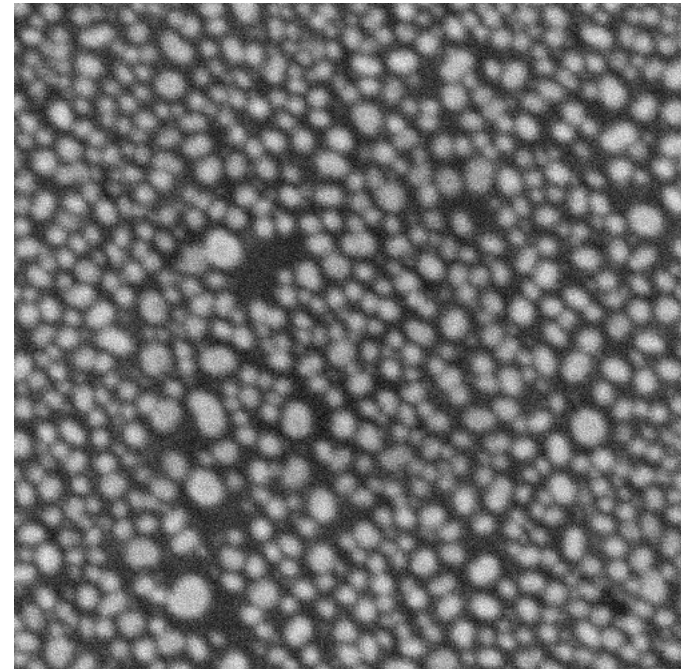
Condition HV:1.5kV Ip:7pA FOV=0.5um

Gold-Particle Sample

EMU-270




EMU-270
AB-Corrector搭載



国際半導体技術ロードマップ

3. 主力製品EMUの性能向上と販売促進について

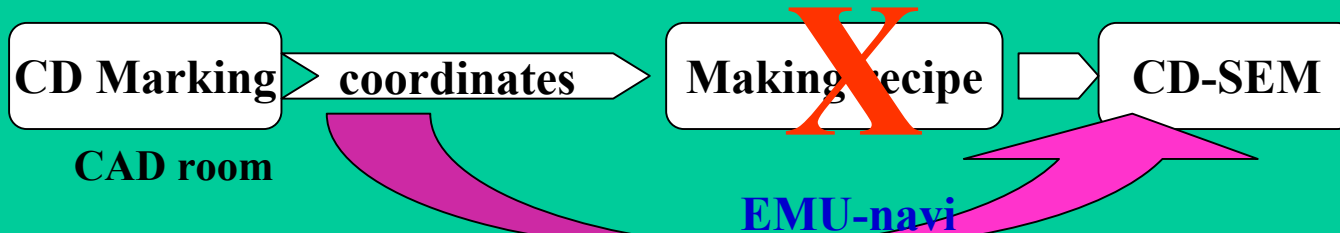
Year of Production	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
DRAM 1/2 Pitch (nm)	80	70	65	57	50	45	40	
Flash 1/2 Pitch (nm)	76	64	57	51	45	40	36	
Mask nominal image size (nm)	214	191	170	151	136	120	107	
Mask minimum future size (nm)	150	133	119	106	94	84	75	
Minimum OPC size (nm)	90	80	70	64	56			
Mask iso line CD uniformity (nm 3 σ)	3.8	3.3	2.6	2.0	1.7	1.4	1.2	
Mask contact CD control (nm, 3 σ)	4.7	4.0	3.0	2.4	2.1	1.9	1.7	
Mask iso line CD precision (nm, 3 σ)	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	
Mask contact CD precision (nm, 3 σ)	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	
			<i>EMU-270A spec coverage</i> 					

EMUの自動測定機能

3.主力製品EMUの性能向上と販売促進について

Requirement for reliable automated measurement to save recipe creation time and human resource

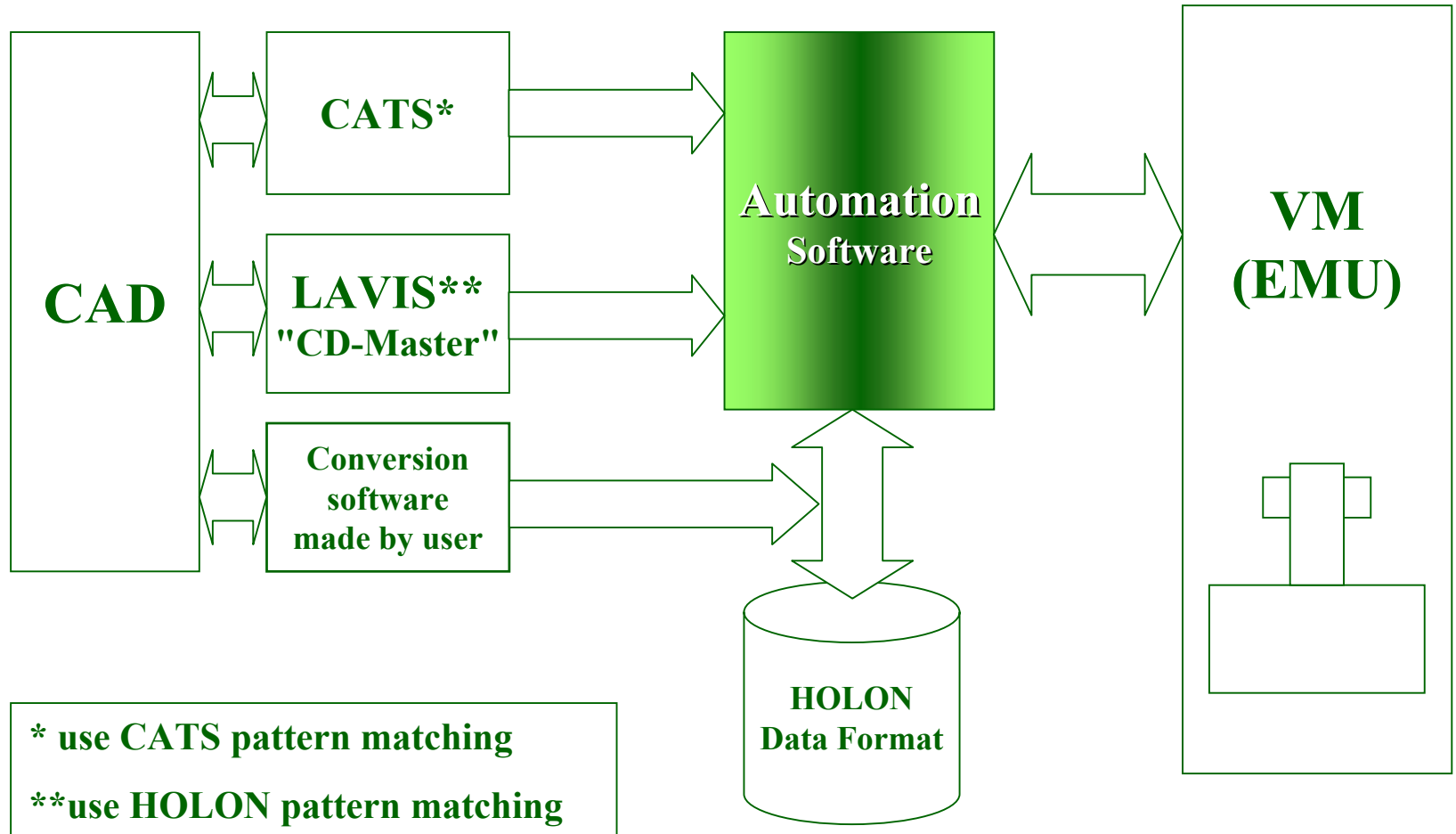
Automated recipe making



CAD-Link recipe making system
“CD-Master”

EMUナビシステム

3.主力製品EMUの性能向上と販売促進について



EMU-270 (マスクCD-SEM)

3.主力製品EMUの性能
向上と販売促進について



業績見通しの開示について

- 本資料に記載されている内容は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、下記のリスク等や不確定要因等を含んだものであることをご了承願います。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果に関わらず、常に株式会社ホロンが将来の見直しを見直すとは限りません。
- 当社の製品については国内販売については検収基準、海外については船積基準を原則として売上を計上しております。本資料における売上見込みは現時点での進捗見込みに基づくものであり、検収が遅れるリスクを含んでおります。
- また、当社を取り巻く経済情勢、株式市場動向等により、実際の業績等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。